



①⑨ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 100 63 239 A 1**

⑤① Int. Cl. 7:
G 03 F 7/20
G 02 B 13/14
G 02 B 13/18

③
DE 100 63 239 A 1

⑲ Aktenzeichen: 100 63 239.4
⑳ Anmeldetag: 19. 12. 2000
㉑ Offenlegungstag: 28. 6. 2001

③⑩ Unionspriorität:
11-362257 21. 12. 1999 JP

⑦① Anmelder:
Nikon Corp., Tokio/Tokyo, JP

⑦④ Vertreter:
Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser,
80538 München

⑦② Erfinder:
Kumagai, Satoru, Chigasaki, Kanagawa, JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

⑤④ Projektionsbelichtungseinrichtung und Verfahren zur Herstellung von Geräten unter deren Verwendung

⑤⑦ Um eine Projektionsbelichtungseinrichtung zur Verfügung zu stellen, die eine hohe optische Qualität bei der Herstellung von Geräten bei einer Lichtquelle erzielen kann, die Vakuumultraviolettlicht verwendet, ist ein optisches Beugungselement, das auf einem Substrat vorgesehen ist, das aus Quarzglas mit einer kleinen Menge an einer anderen Substanz besteht (beispielsweise Fluor, Hydroxylradikal, Wasserstoff, und/oder Kombinationen hieraus) in dem optischen Projektionssystem und/oder dem optischen Beleuchtungssystem der Belichtungseinrichtung vorgesehen.

DE 100 63 239 A 1